_____ ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ____ ТЕХНИКА

УДК 621.383.92

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХРЕЖИМНОЙ РАБОТЫ ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

© 2019 г. О. Ю. Горбадей^{*a*}, А. О. Зеневич^{*a*,*}, Е. В. Новиков^{*a*}, С. А. Гоибов^{*a*}

^а Белорусская государственная академия связи Беларусь, 220114, Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2 *e-mail: a.zenevich@bsac.by

> Поступила в редакцию 13.07.2018 г. После доработки 13.07.2018 г. Принята к публикации 19.08.2018 г.

Показана возможность одновременной работы лавинных фотодиодов в режиме счета фотонов и токовом режиме. Двухрежимная работа обеспечена при постоянном напряжении питания лавинного фотодиода, превышающем напряжение пробоя его *p*–*n*-перехода. Приведены оценки вероятности образования микроплазменных импульсов от интенсивности оптического излучения и напряжения питания лавинного фотодиода для рассматриваемого режима работы.

DOI: 10.1134/S0032816219020113

введение

В настоящее время лавинные фотодиоды (л.ф.д.) находят широкое применение для регистрации оптического излучения в лидарных системах, оптической рефлектометрии волоконнооптических линий связи, в квантовых информационных системах [1-3]. В этих случаях использование л.ф.д. предполагает сочетание двух режимов работы: токового и счета фотонов, что обусловлено необходимостью регистрировать оптическое излучение в широком диапазоне интенсивностей. Токовый режим работы используется для регистрации достаточно мощного оптического излучения, а режим счета фотонов применяется для регистрации излучения малой мощности [4]. В токовом режиме л.ф.д. обычно работают при напряжениях питания U_n, меньших напряжения пробоя его p-n-перехода $U_{\text{пр}}$.

В работе [5] для сочетания двух этих режимов применялся управляемый источник питания, который устанавливал напряжение питания л.ф.д. выше или ниже $U_{\rm np}$ в зависимости от того, какой из режимов регистрации использовался. Применение такого источника питания со схемой управления усложняет устройство регистрации. Постоянное переключение напряжения питания также может привести к выходу л.ф.д. из строя.

Целью данной работы является анализ возможности реализации токового режима работы и режима счета фотонов при постоянном напряжении питания лавинного фотодиода, превышающем напряжение пробоя его p-n-перехода.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве объектов исследования были использованы кремниевые лавинные фотодиоды промышленного изготовления ФД-115Л и экспериментальные лавинные фотодиоды со структурой $n^+ - p - \pi - p^+$.

Исследования выполнены на установке, структурная схема которой представлена на рис. 1.

Установка функционирует следующим образом. На светодиод $C\mathcal{A}_1$ от генератора Γ поступают прямоугольные импульсы. В результате светодиод $C\mathcal{A}_1$ формирует импульсное оптическое излучение, которое поступает на набор нейтральных светофильтров H_1 . Набор светофильтров H_1 обеспечивает требуемое ослабление интенсивности оптических импульсов, направляемых на первый вход оптического смесителя Cm.

От источника U_1 на светодиод $C\mathcal{A}_2$ подается постоянное напряжения питания, в результате чего светодиод $C\mathcal{A}_2$ испускает оптическое излучение постоянной интенсивности. Это оптическое излучение через набор нейтральных светофильтров H_2 и диафрагму \mathcal{A} подается на второй вход оптического смесителя Cm. Диафрагма \mathcal{A} используется для перекрытия в необходимых случаях потока оптического излучения. Светодиод $C\mathcal{A}_2$ обеспечивает таким образом стационарную подсветку л.ф.д.

Коэффициенты ослабления обоих наборов нейтральных светофильтров H_1 и H_2 могли регу-



Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки. Γ – генератор прямоугольных импульсов, U_1 , U_2 – источники постоянного напряжения, $C\mathcal{A}_1$, $C\mathcal{A}_2$ – светодиоды, H_1 , H_2 – наборы нейтральных светофильтров, \mathcal{A} – диафрагма, C_M – оптический смеситель, OB – оптическое волокно, A – амперметр, B – вольтметр, л.ф.д. – лавинный фотодиод, R_H – резистор нагрузки, Ocu – осциллограф, Y – усилитель импульсов, $A\mathcal{A}$ – амплитудный дискриминатор, $A\Pi K$ – аппаратно-программный комплекс.

лироваться в широком диапазоне, обеспечивая ослабление интенсивности излучения до 10⁵ раз.

Смеситель *См*, объединив оптические излучения от светодиодов $C\mathcal{A}_1$ и $C\mathcal{A}_2$, направляет их в оптическое волокно *OB*, с выхода которого излучение поступает на лавинный фотодиод.

Лавинный фотодиод включен последовательно с нагрузочным резистором R_н (рис. 1). На л.ф.д. подается постоянное напряжение питания $U_{\rm n} \ge U_{\rm np}$ от источника И₂ через амперметр А. Напряжение контролируется вольтметром В. При таком включении под воздействием оптических импульсов в фотодиоде формируются импульсы тока. Вместе с тем при этих напряжениях питания в л.ф.д. могут возникать импульсы тока, вызванные микроплазменным пробоем *p*-*n*-перехода. К появлению этого пробоя приводят термогенерированные свободные носители заряда, образующиеся в области умножения носителей заряда *p*-*n*-перехода, или свободные носители заряда, возникшие в этой области под воздействием стационарного оптического излучения светодиода СД₂. Далее такие импульсы будут называться микроплазменными.

Токовые импульсы, независимо от их происхождения, изменяют падение напряжения на нагрузочном резисторе $R_{\rm H}$, формируя импульсы напряжения, которые усиливаются усилителем *У*. С выхода усилителя импульсы поступают на вход амплитудного дискриминатора *АД*. Вид импульсов напряжения на выходе усилителя контролируется осциллографом.

Амплитудный дискриминатор отделяет собственные шумы усилителя от микроплазменных импульсов фотодиода и импульсов, вызванных оптическими сигналами светодиода $C\mathcal{I}_1$. Импульсы с выхода дискриминатора $A\mathcal{I}$ подаются на вход аппаратно-программного комплекса *АПК*. Аппаратно-программный комплекс на базе компьютера позволяет определять вероятность появления микроплазменных импульсов.

Напряжение пробоя л.ф.д. $U_{\rm np}$ определялось по его вольт-амперной характеристике согласно методике, рассмотренной в работе [6]. Для исследуемых лавинных фотодиодов оно составляло 51.4 В для ФД-115Л и 190.2 В для л.ф.д. со структурой $n^+-p-\pi-p^+$.

Использовалось оптическое излучение с длиной волны $\lambda = 650$ нм для обоих светодиодов.

Измерения проводились при постоянном значении температуры T = 293 К.

Характеристики генератора Γ изменялись в следующих диапазонах: длительность оптических импульсов 0.1–10 мкс; частота следования импульсов 10^3 – 10^5 Гц.

Поскольку отдельные экземпляры исследуемых лавинных фотоприемников имеют разное напряжение пробоя, то для сравнения их характеристик между собой использовалась величина перенапряжения $\Delta U = U_{\Pi} - U_{\Pi p}$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки возможности одновременной реализации токового и счетного режимов регистрации на исследуемые л.ф.д. подавалось одинаковое перенапряжение $\Delta U = 0.1$ В и на них последовательно направлялось оптическое излучение только от светодиода $C\mathcal{A}_1$, а затем одновременно от светодиодов $C\mathcal{A}_1$ и $C\mathcal{A}_2$. Полученные осциллограммы усиленных выходных сигналов л.ф.д. со структурой $n^+ - p - \pi - p^+$ представлены на рис. 2. Отметим, что осциллограммы выходных сигна

0.4

0.3

0.2

0.1

0



Рис. 2. Осциллограммы усиленных выходных сигналов л.ф.д. со структурой $n^+ - p - \pi - p^+$ при $\Delta U = 0.1$ В без внешней засветки (**a**) и с засветкой (**б**). 1 - импульсы, обусловленные оптическими импульсами светодиода $C\mathcal{I}_1$; 2 - микроплазменные импульсы.

лов для лавинного фотодиода ФД-115Л имели аналогичный вид.

Как видно из приведенных результатов на рис. 2а, между импульсами, инициированными в л.ф.д. оптическими импульсами светодиода $C\mathcal{I}_1$, появляются микроплазменные импульсы, создаваемые в лавинном фотодиоде термогенерированными свободными носителями заряда. Длительность микроплазменных импульсов приблизительно одинакова как для л.ф.д. со структурой $n^+ - p - \pi - p^+$, так и для лавинных фотодиодов ФД-115Л, и составляет ~ 1 мкс. Отметим, что длительность т оптических импульсов $C\mathcal{I}_1$ выбиралась равной средней длительности микроплазменных импульсов, а частота их следования составляла $4 \cdot 10^4$ Гц.

В процессе выполнения измерений имелась возможность изменения энергетической экспозиции H импульсов, формируемых светодиодом $C\mathcal{A}_1$, в диапазоне 6.7 · 10⁻⁸–2.2 · 10⁻⁵Дж/см². Амплитуда импульсов, сформированных оптическим излучением светодиода $C\mathcal{A}_1$ на нагрузочном резисторе фотодиода, естественным образом зависела от величины H. Для значений $H \le 2.4 \cdot 10^{-6}$ Дж/см² ам-



0.2

импульсов было практически невозможно. Максимальное количество микроплазменных импульсов, которое могло уложиться в интервале времени $t = t_1 - \tau$ (где t_1 – период следования оптических импульсов), составляло $N_0 = 21$.

0.4

0.6

0.8

J, мВт/м²

Вероятность образования микроплазменных импульсов P определялась как отношение N/N_0 , где N – среднее число импульсов, зарегистрированных за время t.

При одновременном поступлении оптического излучения от светодиодов $C\mathcal{A}_1$ и $C\mathcal{A}_2$ на л.ф.д. увеличивается количество микроплазменных импульсов за интервал времени *t* (см. рис. 26) и, следовательно, растет вероятность *P* для всех исследуемых фотодиодов.

Зависимость вероятности *P* от интенсивности *J* стационарного оптического излучения имела линейный участок для всех исследуемых л.ф.д. (см. рис. 3). Линейный участок соответствовал интервалу интенсивностей стационарной подсветки $0-4 \cdot 10^{-4}$ Вт/м² для фотодиодов ФД-115Л и $0-5 \cdot 10^{-4}$ Вт/м² для л.ф.д. со структурой $n^+-p-\pi-p^+$.

Дальнейшее увеличение интенсивности оптического излучения приводило к насыщению зависимости *P* от *J*. Такое поведения связано с тем, что при больших интенсивностях оптического излучения проявляется влияние мертвого времени [4], обусловленное тем, что в течение определен-



Рис. 4. Зависимость вероятности образования микроплазменных импульсов от ΔU для л.ф.д. двух типов: $1 - \Phi Д$ -115Л; $2 - л.\phi.д.$ со структурой $n^+ - p - \pi - p^+$.

ного промежутка времени после возникновения в л.ф.д. микроплазменного импульса электрическое поле в области p—n-перехода восстанавливается до допробойного значения. В этот промежуток времени микроплазменные импульсы в л.ф.д. не формируются, диод нечувствителен к падающему на него излучению. С ростом интенсивности оптического излучения вероятность поступления фотона на л.ф.д. в течение этого времени увеличивается. В результате возникают просчеты фотонов, и, как следствие, зависимость P от J отклоняется от линейной.

Из наличия линейного участка зависимостей P от J для всех исследуемых фотоприемников следует, что в промежуток времени t л.ф.д. работают в режиме счета фотонов только при тех интенсивностях J, которые соответствуют этому участку.

Установлено, что минимальный интервал между импульсом, вызванным оптическим излучением светодиода $C \square_1$, и появлением за ним первого микроплазменного импульса составляет ~0.1 мкс.

Величина H оптического импульса, сформированного светодиодом $C\mathcal{A}_1$, для длительностей от 0.1 до 10 мкс не оказывала влияния на вероятность образования микроплазменных импульсов P в исследуемом диапазоне энергетических экспозиций.

Увеличение напряжения питания л.ф.д. приводило к росту количества микроплазменных импульсов, образованных термогенерированными носителями заряда, а также к увеличению амплитуды импульсов, сформированных оптическим излучением от светодиода $CД_1$ при постоянной энергетической экспозиции. Зависимости вероятности образования микроплазменных импульсов, образованных термогенерированными носителями, от величины ΔU представлены на рис. 4 для частоты следования $4 \cdot 10^4$ Гц и длительности оптических импульсов светодиода $C\mathcal{I}_1$ 2 мкс. Оптическое излучение от светодиода $C\mathcal{I}_2$ при этом отсутствовало. Исследования выполнены для диапазона перенапряжений $\Delta U = -0.2 \dots +0.4$ В. При $\Delta U < -0.2$ В микроплазменные импульсы в л.ф.д. не возникали. С увеличением $\Delta U > 0.4$ В значительно увеличивался электрический ток, протекающий через л.ф.д., что могло привести к тепловому пробою p-n-перехода.

При изменении ΔU от -0.2 до 0.1 В линейный участок зависимости P от J увеличивался. Это связано с уменьшением значения мертвого времени л.ф.д. при увеличении ΔU в этом диапазоне перенапряжений. Такое изменение длительности мертвого времени обусловлено уменьшением последовательного сопротивления л.ф.д. с увеличением ΔU в интервале от -0.2 до 0.1 В. Отметим, что собственная емкость л.ф.д. при этом оставалась неизменной. Дальнейшее увеличение перенапряжения не приводит к увеличению последовательного сопротивления л.ф.д. и поэтому длительность мертвого времени для $\Delta U > 0.1$ В остается постоянной.

Установлено, что увеличение перенапряжения увеличивает вероятность появления микроплазменных импульсов, вызванных термогенерированными носителями, для всех исследуемых л.ф.д. Последнее обусловлено тем, что рост напряжения питания приводит к увеличению объема области микроплазменного пробоя p-n-перехода л.ф.д. и соответственно к повышению вероятности попадания термогенерированного носителя в эту область и формирования микроплазменного пробоя [4, 6]. Отметим, что увеличение вероятности образования микроплазменных импульсов, вызванных термогенерированными носителями заряда, влекло за собой уменьшение линейного участка зависимости *P* от *J* в интервале перенапряжений от 0.1 до 0.3 В. Так, линейный участок при увеличении перенапряжения от 0.1 до 0.3 В уменьшается для фотодиодов ФД-115Л в 1.3 раза, а для л.ф.д. со структурой $n^+ - p - \pi - p^+ - в$ 1.2 раза.

Более сильную зависимость *P* от ΔU имели фотодиоды ФД-115Л. Так, для фотодиодов ФД-115Л отношение $\Delta P/\Delta U_{\rm n} = 0.8 \text{ B}^{-1}$, а для л.ф.д. со структурой $n^+ - p - \pi - p^+ - 0.3 \text{ B}^{-1}$ (ΔP – изменение вероятности появления микроплазменных импульсов, $\Delta U_{\rm n}$ – изменение приложенного к л.ф.д. напряжения питания).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о возможности одновременной реализации режима счета фотонов и токового режима для лавинных фотодиодов, что расширяет область их практического применения. Двухрежимная работа обеспечивается при постоянном напряжении питания фотодиода, превышающем напряжение пробоя его *p*–*n*-перехода.

Определены зависимости вероятности образования микроплазменных импульсов в лавинных фотодиодах от интенсивности падающего на него оптического излучения, сформированного стационарной подсветкой. Показано, что данные зависимости имеют линейный участок и реализация режима счета фотонов возможна только для интенсивностей оптического излучения, соответствующих этому участку.

Показано, что увеличение вероятности образования микроплазменных импульсов, вызванных термогенерированными носителями заряда, приводит к уменьшению линейного участка зависимости вероятности образования микроплазменных импульсов от интенсивности засветки. Это обуславливает сокращение динамического диапазона регистрации лавинного фотодиода в режиме счета фотонов. Установлено, что фотодиоды ФД-115Л имели более сильную зависимость вероятности образования микроплазменных импульсов от напряжения питания, чем л.ф.д. со структурой $n^+ - p - \pi - p^+$.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № Т16К-006).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Килин С.Я.* Квантовая криптография: идеи и практика. Минск: Белорус. наука, 2007.
- 2. Василиу Е.В., Мамедов Р.С. // Цифрові технологіі. 2009. № 6. С. 94.
- Зеневич А.О. Обнаружители утечки информации из оптического волокна. Минск: Белорус. гос. академия связи, 2017.
- 4. *Гулаков И.Р., Зеневич А.О.* Фотоприемники квантовых систем. Минск: Высший гос. колледж связи, 2012.
- 5. Гулаков И.Р., Зеневич А.О., Тимофеев А.М. Патент 17012 РБ. МПК (2006.01) G 08 C 23/00 // Офиц. бюл. Нац. центра интеллектуальной собственности. 2013. № 2. С. 145.
- 6. *Грехов И.В., Сережкин Ю.Н.* Лавинный пробой *р*-*n*-перехода в полупроводниках. Л.: Энергия, 1980.